

## DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Evaluación Parcial 27 de junio de 2022 Tema 2



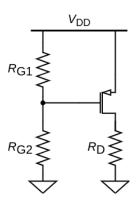
Nombre y apellido:		
Padrón:	Turno:	N° de examen:

- Es condición necesaria para aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada ejercicio esté correctamente planteado.
- Se considerará: La claridad y síntesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los gráficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.
- Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojas independientes.

Calificación:

Constantes:  $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \,\mathrm{kg}; \ k = 1.38 \times 10^{-23} \,\mathrm{J/K}; \ h = 6.62 \times 10^{-34} \,\mathrm{Js}; \ q = 1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}; \ \epsilon_{r,SiO_2} = 3.9; \ \epsilon_{r,Si} = 11.7; \ \epsilon_0 = 88.5 \,\mathrm{fF/cm}.$ 

- 1) Respecto de estructuras MOS y transistores MOSFET:
  - a) Considere un capacitor MOS con  $t_{\rm ox}=85\,{\rm nm},\,n_{\rm i}=1\times10^{10}\,{\rm cm^{-3}}\,(T=300\,{\rm K}),\,$   $W=40\,{\rm \mu m},\,L=10\,{\rm \mu m},\,{\rm y}$  un dopaje en el substrato  $N_{\rm A}=1\times10^{16}\,{\rm cm^{-3}}\,(\mu_{\rm n}=1200\,{\rm cm^2\,V^{-1}\,s^{-1}},\,\mu_{\rm p}=450\,{\rm cm^2\,V^{-1}\,s^{-1}}).$  Calcule la carga en la interfaz entre el óxido y el semiconductor, cuando  $V_{GB}=2,5\,{\rm V}.$
  - b) A partir de la estructura MOS del punto anterior, se construye un transistor MOSFET, agregando el source y el drain y se polariza con  $|I_{\rm D}|=1\,{\rm mA},$   $|V_{\rm DS}|=2\,{\rm V}$  y  $V_{\rm BS}=0\,{\rm V}.$  Además se sabe que el  $\lambda$  que se obtiene se puede despreciar. Dibuje el modelo completo de pequeña señal del transistor para bajas frecuencias y calcule sus parámetros.
  - c) Dado el circuito de la figura de la derecha, obtener la polarización considerando  $k=0.35\,\mathrm{mA\,V^{-2}},\ V_\mathrm{T}=-1\,\mathrm{V},\ \lambda=0.13\,\mathrm{V^{-1}},\ R_\mathrm{G1}=47\,\mathrm{k}\Omega,\ R_\mathrm{G2}=33\,\mathrm{k}\Omega,\ R_\mathrm{D}=4.7\,\mathrm{k}\Omega$  y  $V_\mathrm{DD}=3.3\,\mathrm{V}$ .



- a) Tres muestras de Silicio con misma geometría (largo y área) son dopadas con tres densidades de impurezas donoras distintas, obteniéndose tres valores de movilidad distintos: μ = {1400; 800; 300}cm²/(Vs). A cada una de ellas se le aplica la misma tensión V, obteniéndose 3 corirentes distintas circulando por cada muestra siendo I<sub>1</sub> > I<sub>2</sub> > I<sub>3</sub>. Relacionar cada corriente obtenida con cada uno de los dopajes y movilidades. Explicar por qué varía la movilidad, indicando un valor aproximado de denisdad de dopaje para cada muestra. Justificar la respuesta.
  - b) Dos diodos son fabricados con el mismo material semiconductor y mismos niveles de dopaje, pero con distinta área siendo  $A_{D_1}=100\times A_{D_2}=0.1\,\mathrm{mm^2}$ . Los diodos tienen como parámetros su densidad de corriente de saturación inversa  $J_S=3\,\mathrm{nA\,cm^{-2}}$ , la densidad de corriente de generación  $J_{gen}=0.1\,\mathrm{mA\,cm^{-2}}$ , y el coeficiente de idealidad n=1,2. Ambos están conectados como se muestra en la figura, donde  $V_{DD}=3\,\mathrm{V}$  y  $R=100\,\mathrm{M}\Omega$ . Calcular de forma aproximada la caída de tensión y la corriente que circula por cada uno de los diodos. Indicar todas las aproximaciones e hipótesis utilizadas en la resolución.

